

# Dispositivo De Purga Con Gas Inerte De Pfa De Alta Pureza Para Análisis De Trazas De Precursores Semiconductores. Sistema De Purga Compatible Con Nitrógeno Y Argón

Número de artículo: PL-CP429



## Introducción

Dispositivo de purga con gas inerte de PFA de ultra alta pureza para detección y análisis de trazas de precursores semiconductores. Diseñado para purgas con nitrógeno o argón que previenen la oxidación y contaminación de muestras en flujos de trabajo críticos de laboratorio. Construcción duradera resistente a químicos para investigación profesional.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Pruebas de precursores semiconductores	Purga de precursores organometálicos con argón para evitar la oxidación antes del análisis por ICP-MS.	Garantiza una caracterización precisa de precursores para ALD/CVD.
Control de calidad para fabricación de CI	Purga con gas de alta pureza para análisis de metales traza en productos químicos de proceso.	Reduce el límite de detección al eliminar la contaminación originada en los materiales.
Investigación de electrolitos para baterías	Protección de componentes de baterías de litio sensibles a la humedad durante la extracción de disolventes y la purga.	Mantiene la estabilidad del electrolito para pruebas electroquímicas consistentes.
Síntesis de catalizadores	Gestión de catalizadores sensibles al aire durante la transición de la síntesis al análisis.	Evita el envenenamiento del catalizador por oxígeno o humedad atmosférica.
Análisis de trazas petroquímicas	Eliminación de fracciones volátiles de matrices de hidrocarburos complejas mediante desplazamiento con nitrógeno.	Excelente resistencia a compuestos y disolventes agresivos que contienen azufre.
Preparación de nanomateriales avanzados	Mantenimiento de un entorno inerte durante la preparación de muestras de nanopartículas funcionalizadas.	Preserva la química superficial y evita la oxidación superficial no deseada.
Análisis de gases especiales	Actúa como interfaz de alta pureza para el muestreo y análisis de gases electrónicos de alta pureza.	Evita el ruido de fondo por fugas atmosféricas o desgasificación de materiales.

Característica	Detalles de especificación (PL-CP429)
<b>Material principal</b>	PFA (Perfluoroalcoxi) de ultra alta pureza
<b>Proceso de fabricación</b>	Mecanizado CNC de precisión / Fabricación personalizada
<b>Capacidad estándar</b>	30 ml (Tamaños personalizados disponibles bajo solicitud)
<b>Compatibilidad con gases</b>	Nitrógeno (N <sub>2</sub> ), Argón (Ar), Helio (He) y otros gases inertes
<b>Resistencia química</b>	Resistencia a todos los disolventes comunes, ácidos fuertes y bases
<b>Rango de temperatura</b>	Totalmente personalizable según los requisitos de temperatura de la aplicación específica
<b>Clasificación de presión</b>	Diseño optimizado para presiones de purga de gas estándar (Personalizable)
<b>Puertos de conexión</b>	Adaptados para encajar en sus líneas de gas existentes e interfaces de instrumentos analíticos

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Característica	Detalles de especificación (PL-CP429)	
Protocolo de limpieza	Compatible con procedimientos de lavado con ácido y limpieza de alta pureza	